

資料3-2

評価対象物(A物質)にかかるばく露実態調査と防止措置との関係(イメージ)

作業内容		個人ばく露濃度測定	スポット測定	A測定	ばく露レベル	ばく露防止措置の対象
		低 ↔ 高 TLV=0.5ppm	低 ↔ 高 STEL=4.0ppm	低 ↔ 高 仮管=0.5ppm		
8:40	出勤					
9:00	受注の確認等(事務)					
9:10	作業工程の確認					
9:30	作業開始(物質Aの搬入)	(0.4ppm)				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px;"> ※ばく露防止措置の対象は、A物質の取扱いに限定される。 </div>
9:50	投入準備(物質A)	(0.75ppm)	↕ 1.5ppm			
11:00	投入(物質A)	(2.5ppm)	↕ 4.8ppm			
11:30	反応工程の確認(物質A)	(0.3ppm)				
12:00	昼休憩					
13:00	反応工程の監視(物質A)	(0.3ppm)				
14:20	反応生成物(B物質)の取り出し					
15:00	生成物のドラム缶充填					
15:50	ドラム缶の搬出(B物質)					
16:35	反応槽の洗浄(B物質)					
16:50	作業の記録					
17:25	退社					
		TWA=0.4ppm				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px;"> 個人ばく露濃度は適合 </div>

作業環境の問題有

短時間ばく露値に問題有